

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー  
大気圧プラズマによる低コスト薄膜の作製技術  
とその応用  
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構  
協力：石川県工業試験場

薄膜は、工具や金型等の寿命向上および既存製品に機能を付与することができることから、様々な分野で応用・実用化されています。その中でも近年、低コストで実用化可能な大気圧プラズマ CVD 法が注目されています。本手法は、従来低圧下で行っていた薄膜の合成を大気圧下で行うことができる手法であり、フィルムのような平板基材や立体構造を持つ基材など多様な形状への薄膜合成が可能となります。また、大気圧下での薄膜合成は、真空設備が不要になることや処理時間が短くなることが特徴であり、低コスト化と大量生産が可能となります。

本講座では、この大気圧プラズマ技術の基本とその応用技術について事例を交えて紹介します。多数ご参加くださいますようお願いいたします。

[日 時] 平成29年11月21日(火) 14:00~16:00

[場 所] 石川県工業試験場 第2会議室(石川県工業試験場 2階)

[講 師] 慶應義塾先端科学技術研究センター 所長  
慶應義塾大学理工学部 機械工学科 教授

鈴木 哲也 氏

[受講料] 1,000円(当日ご持参ください)

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 機械金属部 主任研究員 安井 治之

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@iriii.jp

TEL: (076) 267-8081 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 平成29年11月14日(火)(定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：「大気圧プラズマによる低コスト薄膜の作製技術とその応用」

日 時：平成29年11月21日(火) 14:00~16:00

場 所：石川県工業試験場 第2会議室(石川県工業試験場 2階)

会 社 名

住 所(〒)

電 話

FAX

所 属	氏 名	e-mail